

Invenția se referă la electronică, în particular la nanotehnologiile de obținere a materialelor nanostructurate și nanocompozitelor.

Nanotehnologia de obținere a materialelor nanostructurate și nanocompozitelor, conform primei variante, include depunerea componentelor chimice pe un substrat în prezența razelor ultraviolete. Apoi are loc procesarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid sau în aer, sau în camera cu gaze, de exemplu, cu oxigen.

Nanotehnologia de obținere a materialelor nanostructurate și nanocompozitelor, conform variantei a doua, include depunerea componentelor chimice pe un substrat în prezența razelor ultraviolete, iar o dată cu depunerea componentelor chimice are loc doparea materialelor obținute cu cel puțin o impuritate donoare sau acceptoare. Apoi are loc procesarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid sau în aer, sau în camera cu gaze, de exemplu, cu oxigen.

Nanotehnologia de obținere a materialelor nanostructurate și nanocompozitelor, conform variantei a treia, include depunerea componentelor chimice pe un substrat în prezența razelor ultraviolete, apoi se efectuează doparea prin difuzie cu cel puțin o impuritate donoare sau acceptoare o dată cu procesarea fototermică rapidă a materialelor obținute în vid sau în aer, sau în camera cu gaze, de exemplu, cu oxigen.

Nanotehnologia de obținere a materialelor nanostructurate și nanocompozitelor, conform variantei a patra, include depunerea componentelor chimice pe un substrat în prezența razelor ultraviolete, apoi se efectuează doparea prin difuzie cu cel puțin o impuritate donoare sau acceptoare. Concentrația impurităților introduse la dopare este maxim posibilă pentru materialul obținut. Ulterior are loc procesarea fototermică rapidă a materialelor obținute în condițiile micșorării de la temperatura dopării până la temperatura mediului înconjurător în vid sau în aer, sau în camera cu gaze, de exemplu, cu oxigen.

Revendicări: 10

Figuri: 3